

Title (en)

Development bath after phosphoric anodisation of titanium alloy.

Title (de)

Entwicklerbad nach Phosphorsäure-Anodisierung einer Titanlegierung.

Title (fr)

Bain de révélation après anodisation phosphorique sur alliage de titane.

Publication

EP 0527062 A1 19930210 (FR)

Application

EP 92401617 A 19920611

Priority

FR 9107147 A 19910612

Abstract (en)

[origin: FR2677669A1] Development bath after phosphoric anodising on titanium alloy for an electrochemical etching process known by the name of "BLUE-ETCH". In accordance with the invention this bath consists, in addition to the known solution, of: - 320 g/l of nitric acid - 13 to 22 g/l of hydrofluoric acid - water in sufficient quantity for 1 l of 4 to 7 g/l of dissolved titanium. <??>This process is particularly suitable for nondestructive checking of turbine vanes and discs made of titanium or titanium alloy.

Abstract (fr)

L'invention concerne un bain de révélation après anodisation phosphorique sur alliage de titane pour procédé d'attaque électrochimique connu sous la désignation de "BLUE-ETCH". Conformément à l'invention, ce bain se compose, en plus de la solution connue de : acide nitrique 320 g/l, acide fluorhydrique 13 à 22 g/l, eau en quantité suffisante pour 1 l de 4 à 7 g/l de, eau en quantité suffisante pour 1 l de 4 à 7 g/l de titane dissous. Ce procédé convient particulièrement pour le contrôle non destructif des aubes et disques de turbomachine en titane ou alliage de titane.

IPC 1-7

C25D 11/26

IPC 8 full level

C25F 3/08 (2006.01); **C25D 11/26** (2006.01); **G01N 1/32** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C25D 11/26 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

[A] US 3502552 A 19700324 - MIZUSHIMA WATARU, et al

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

FR 2677669 A1 19921218; FR 2677669 B1 19930910; DE 69210912 D1 19960627; DE 69210912 T2 19961128; EP 0527062 A1 19930210; EP 0527062 B1 19960522; JP H06123000 A 19940506; JP H0735599 B2 19950419; US 5227035 A 19930713

DOCDB simple family (application)

FR 9107147 A 19910612; DE 69210912 T 19920611; EP 92401617 A 19920611; JP 14940792 A 19920609; US 89456692 A 19920605